

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 11 月 24 日 (2006.11.24)

【公開番号】特開 2005-123310 (P2005-123310A)
 【公開日】平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-018
 【出願番号】特願 2003-355046 (P2003-355046)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 27/04 (2006.01)
H 0 1 L 21/822 (2006.01)
C 0 4 B 41/87 (2006.01)
H 0 1 L 21/316 (2006.01)
H 0 1 L 27/105 (2006.01)
H 0 1 L 21/8246 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/04 C
 C 0 4 B 41/87 Z
 H 0 1 L 21/316 B
 H 0 1 L 27/10 4 4 4 C
 H 0 1 L 27/10 4 4 4 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 10 月 5 日 (2006.10.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 強誘電体原料の溶液を用いて、水熱電着法により電極に電着させて強誘電体初期核層を形成する工程と、

第 2 強誘電体原料の粒子を帯電させる工程と、

帯電させた前記第 2 強誘電体原料の粒子を、泳動電着法により前記強誘電体初期核層の上に電着させて強誘電体材料膜を形成する工程と、

前記強誘電体材料膜を熱処理する工程と、を含む、強誘電体膜の製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記強誘電体初期核層は島状に形成される、強誘電体膜の製造方法。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 において、

前記第 2 強誘電体原料はアモルファス状である、強誘電体膜の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれかにおいて、

前記第 2 強誘電体原料の粒子を帯電させる工程は、

前記第 2 強誘電体原料の粒子の表面が多孔質層で覆われたコーティング粒子を形成する工程と、

前記多孔質層にイオンを吸着させる工程と、を含む、強誘電体膜の製造方法。

【請求項 5】

請求項 4 において、

前記多孔質層はシリケートである、強誘電体膜の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の強誘電体膜の製造方法により形成された、強誘電体膜。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の強誘電体膜を有する、強誘電体キャパシタ。

【請求項 8】

請求項 6 に記載の強誘電体膜を有する、強誘電体メモリ。